

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 18 年 7 月 27 日 (2006.7.27)

【公開番号】特開 2005-111729 (P2005-111729A)

【公開日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)

【年通号数】公開・登録公報 2005-017

【出願番号】特願 2003-346433 (P2003-346433)

【国際特許分類】

**B 3 2 B 9/00 (2006.01)**

**C 2 3 C 16/42 (2006.01)**

**G 0 2 F 1/1333 (2006.01)**

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 9/00 A

C 2 3 C 16/42

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

G 0 2 F 1/1333 5 0 5

H 0 5 B 33/02

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 6 月 12 日 (2006.6.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

(珪素を含む透明無機薄膜層 (C))

本発明において、珪素を含有する透明無機薄膜層 (C) として具体的には、窒化珪素薄膜層や酸化窒化珪素薄膜層を代表例として挙げることが出来る。特には窒化珪素膜層 (C 1) であることが好ましい。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 9】

【図 1】本発明における実施形態例の ガスバリアフィルム 断面の概略図である。